

Установки магнетронного напыления SP-203/303/503



Производитель:

ЦУНВ

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установки магнетронного напыления SP-203/303/503 специально разработаны для мелко- и среднесерийных производств. Установки позволяют получать тонкие пленки широкого спектра металлов, диэлектриков и других материалов. Равномерность нанесения материалов типично составляет $\leq 3\%$. В зависимости от конфигурации источников, установки серии SP могут быть оснащены вакуумными камерами различного объема. Модификации SP-203/303/503 перекрывают весь спектр возможных конфигураций внутренней оснастки для работы с пластинами 60 x 48 мм и полупроводниковыми пластинами диаметром 2" - 6". Компактный корпус машины может быть легко размещен в условиях недостатка площадей, конструкция корпуса позволяет разместить установку через стену ЧПП.

Технические характеристики

Диаметр держателя подложек	До 350 мм, или специальный по ТЗ
Размер подложек	60 x 48 мм или 2" - 6"
Размещение магнетронов	Вверх/вниз
Количество/диаметр магнетронов	1 - 5 шт. / 2" - 6"
Тип блоков питания	DC или RF
Нагрев образцов	Опционально до +800 °C
Система откачки	Сухой спиральный насос + турбомолекулярный
Предельное давление	10 ⁻⁷ Торр
Типичная скорость откачки камеры	10 ⁻⁶ Торр за 30 мин.
Контроль давления	Автоматический
Скорость вращения подложки	5 - 30 об./мин.
Равномерность по толщине	±3%, зависит от конфигурации
Система управления	ПЛК/ПЛК+ПК
Отслеживание толщины	По времени или с помощью кварцевого то
Смотровое окно	Есть
Сменные экраны для вакуумной камеры	Есть
Опции	Система нагрева Система охлаждения Ионный источник для очистки или асси Вакуумный шлюз Другие опции под заказ